

## **1** 電気二重層とゼータ電位<sup>1)</sup>

ゼータ電位(ζ)という概念は,電気泳動や電気浸透 の説明の過程で生じたもので,これだけを直接説明する ことは難しいので,まずその準備として電気二重層の説 明を行うことにする。

水溶液と接する固体または液体の界面は,特別の場合 を除き電荷を帯びている。この電荷による電場は,溶液 側から反対符号のイオン(対イオン)を引き寄せ,表面 近傍にイオン雰囲気(電気二重層)を形成する。図1 は,表面が正に帯電している場合の電気二重層の構造 と,対応する電位の分布を模式的に示したものである。 粒子表面周囲のイオン分布が,地球の大気が上層に行く ほど薄くなって拡散した構造になっているのと似た構造 を取っているので,拡散電気二重層と呼ぶ。固体の表面 における電位を表面電位( $\phi_0$ ),または二重層電位と言 い,この対イオンの広がりの程度を電気二重層の厚さ ( $\kappa^{-1}$ )として表す。 $\kappa^{-1}$ は,これから述べるゼータ電 位の大きさや分散系の安定性に対して決定的な役割を演 ずる。

液中に界面活性なイオン,例えばイオン性界面活性剤 や多価イオンが存在すると,これが固体表面に特異吸着 して表面電位を大きく変化させる。最近接距離まで表面 に接近した活性対イオンの中心の面を,シュテルン (Stern)面と言う。シュテルン面と固体表面間の吸着層 をシュテルン層(Stern layer)と言い,シュテルン面に おける電位をシュテルン電位( $\phi_{\delta}$ )と呼ぶ<sup>3)</sup>。 $\phi_{\delta}$ は界 面活性イオンの特異吸着力の強さによって変化し,場合 によっては $\phi_{\delta}$ は $\phi_{0}$ と反対符号になる場合もある。電気 泳動などで実測されるゼータ電位は,これよりさらに外 側の"滑り面"(ずり面とも言う)での電位であるが,



吸着性対イオンの量(A;大,B;中,C;小)によって シュテルン面の電位が変わり,電位分布の様子が大きく 変化する.

#### 図1 電気二重層と電位分布の模式図

多くの場合 $\phi_{\delta} = \zeta$ と近似されている。シュテルン電位  $\phi_{\delta}$ の外側には拡散電位 ( $\phi$ )が存在するが、 $\phi$ はフリー イオン (イオン密度  $n_i$ 、イオン価 $z_i$ )に Poisson – Boltzmann 分布を仮定すると、次のような含まれるイ オン種に対する総和の形で書き表される(以下本章は静 電単位系を用いる)。

$$\Delta^2 \psi = -\frac{1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \sum z_1 e n_1 \exp\left(-\frac{z_1 e \psi}{kT}\right) \quad \dots \dots \dots \dots (1)$$

ここで $\varepsilon_0$ と $\varepsilon_r$ は真空中の誘電率と媒質の比誘電率を,

また e および k は電気素量と Boltzmann 定数を表す。 式(1)は特別な条件下でのみ解くことができ、例えば 界面が平板面の場合、ラプラスオペレーター $\Delta^2 \phi = d^2 \phi / dx^2$  と近似され、1 種類の対称型電解質の系では、 式(1)の2 回積分により次式が求められる。

$$\begin{split} \psi &= \frac{2kT}{ze} \ln \frac{1 + \gamma \exp((-\kappa x))}{1 - \gamma \exp((-\kappa x))} \cdots (2) \\ \gamma &= \frac{\exp((ze\psi_{\delta}/2kT) - 1)}{\exp((ze\psi_{\delta}/2kT) + 1)} \cdots (3) \end{split}$$

ただし

$$\kappa = \sqrt{\frac{2\pi n z^2 e^2}{\varepsilon_0 \varepsilon_r k T}} \cdots (4)$$

ここで  $\phi_{\delta}$ は x=0 (シュテルン面) での電位を示す。いま、  $\phi_{\delta} \leq 25 \text{ mV}$  を満たす小さな  $\phi_{\delta}$ 値の場合  $ze\phi_{\delta} \ll kT$  となり、これを Debye-Huckel 近似と呼び、式(2)は 次のように簡略化される。

$$\psi = \psi_{\delta} \exp((-\kappa x) \cdots (5)$$

式(5)によると、 $x = \kappa^{-1} \circ \phi$ は  $\phi_{\delta}$ から  $\phi_{\delta}/\epsilon$  まで減衰 するので、 $\kappa^{-1}$ を電気二重層の厚さと呼び、イオン雰囲 気の広がりの目安に用いる。式(2)も一見複雑に見え るが、xが大きくなると  $\phi_{\delta}$ はやはり指数関数的に減少 することがわかる。

### 2 動電現象の理論

溶液側に電気二重層を持つ固-液界面に、外部より直 流電場 E を界面に平行に印加したとしよう。固体面は 静止しているので、溶液側に層流が発生すると界面に 沿って速度の分布が生じる。いま、溶液中に微小立方体 を仮定すると、定常状態では立方体に作用する電気力と 粘性力は釣り合わねばならない。立方体中の平均電荷密 度を $\rho$ とすれば電気力は $\rho E$ となり、定常状態では粘性 力( $\eta$  d<sup>2</sup>u/dx<sup>2</sup>)と釣り合っている (SI 単位系)。



ここで u は界面又は粒子と溶液の相対速度, すなわち 電気泳動移動度である。この関係に Poisson の式を代入 し, 整理した後, 両辺を2回積分すると次式が得られ る。

 $V = (\varepsilon_0 \varepsilon_r / \eta) \phi_0 E \quad \cdots \quad (7)$ 

したがって、電気泳動移動度 u = V/E は

 $u = (\varepsilon_0 \varepsilon_r / \eta) \zeta$  .....(8)

で表される。ここで $\eta$ は粘度を示す。また式(8)で は、表面電位  $\phi_0$ をゼータ電位 $\zeta$ に置き換えてある。こ の式は Smoluchowski の式と呼ばれ,最も広く用いられ ている電気泳動の式である。Smoluchowski の式は平板 を対象にして導かれたが,粒子半径(*a*)が電気二重層 の厚さ( $1/\kappa$ )に比べ大きい, $a \gg 1/\kappa$ (または $\kappa a \gg 1$ ), 球状粒子に適用できるばかりでなく,半径の大きな円筒 粒子にも使える。さらに,任意の形状の大きな粒子に適 用できることになるので極めて有用な式と言える。とく に 25℃の水中( $\epsilon_r = 78.5, \eta = 0.89$  mPa)では,式(8) を逆に解いて次式を得る。

 $\zeta = 12.8 \, u \,(\text{mV}) \, \cdots \, (9)$ 

ここで, *u*の単位は µm V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup> cm で与えている。式
 (9)によると 1 µm V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup> cm の泳動度はゼータ電位の値 12.8 mV に対応することがわかる。

動電現象は全く異なった観点からアプローチされている。第二の方法は外部電場が"点電荷に作用する"と考える方法で、Smoluchowski 式の適用極限と逆の極限、つまり小さな粒子半径aまたは二重層が厚い極限、 $a \ll 1/\kappa$ (または $\kappa a \ll 1$ )、で適用できる式で、Hückelの式と呼ばれている。

式(10)を25℃の水中(*ε*<sub>r</sub>=78.5, *η*=0.89 mPa)に適用 し、逆に解くと次式を得る。

 $\zeta = 19.2 \ u \,(\mathrm{mV}) \cdots (11)$ 

ただし、uの単位は $\mu$ m V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup> cm で与える。Hückel の式は, Smoluchowski の式(8)と同様, 粒子の半径aに依存しないが, Smoluchowski の式と比べると, 2/3 の因子がついているところが異なる。すなわち, Hückel の関係式を用いると同じuに対し, Smoluchowski 式に よる値の1.5 倍の $\zeta$ を示す。この矛盾に対して Henry は次のように考えた。Smoluchowski 式では粒子の存在 による電場の歪み(電場は界面に並行に作用している) が考慮されているが, Huckel 式では粒子が非常に小さ く, その存在による外部電場の歪みが無視されている。

この電場の歪みを *κa* の関数として厳密に取り扱った のが Henry<sup>2)</sup>である。Henry はさらに、粒子は静止した 液中を泳動するのではなく、対イオンによって逆方向に 流れている液中を動くための効果(遅延効果)をも考慮 に入れて、次式を導いた。

関数 $f(\kappa a)$ をHenry係数と呼び、粒子の存在による外 部電場の歪みの度合いを表し、 $\kappa a \rightarrow 0$ でf=2/3となり Henry 式はHückelの式になる。逆に、 $\kappa a \rightarrow \infty$ ではf=1となってSmoluchowski式となり、この極限では外部 電場が完全に歪んでいる。また、 $\kappa a$ の中間の値につい



図2 Henry 係数 fの ka による変化

ては図2に示すような値をとる。

電気泳動移動度とゼータ電位の関係にはまだ問題が一 っ残っている。それは、強電解質の電気伝導理論でなじ み深い緩和効果で、外部電場で二重層が変形して非対称 になるために、粒子に逆の電気力が作用する効果であ る。この取り扱いは数学的困難を伴うため、まず Wiersema-Loeb-Overbeek (W-L-O)<sup>3)</sup>によって、コン ピュータによる数値解析法が試みられた。その後さらに、 O'Brien-White<sup>4)</sup>によって数値解析のための、より優れ たプログラムが発表された。このプログラムによる計算 結果の一例を図3に示す。ただし、縦軸 $U_{\rm E}$ と横軸Zは それぞれ無次元化した泳動度とゼータ電位で次式で定義 される。

彼らの計算結果を要約すると次のようになる。

- a) ゼータ電位が 50 mV 以下のコロイド系の電気泳動で は,緩和効果は無視できる。
- b) κa≥1 または κa≪1 を満足するコロイド系では、緩 和効果の影響は少ない。
- c) 1<κa<100 でゼータ電位が 75 mV 以上のコロイド 系の u は緩和効果に大きく影響され、u の値からゼー タ電位を見積もるのが困難になる。
- とりわけ c) の結論は留意すべき点と考える。

### 3 電気泳動法によるゼータ電位の測定

電気泳動法は溶液内に一定の直流電場をかけ、その電 場内を泳動する粒子の速度 u を測定する。泳動する粒 子が顕微鏡下で観察できる場合は、光学顕微鏡や限外顕 微鏡で粒子の泳動を直接観察することができる。

8  $\kappa a = 0$ 7 100 6 5  $U_{\rm E}$ 4 20 3 2 1 0 0 1  $\mathbf{2}$ 3 4 5 6 7 図中の縦軸 UEと横軸 Z はそれぞれ,  $U_{\rm E} = \frac{3\eta z e}{2 \, \varepsilon_{\rm r} \varepsilon_0 \, kT} \, u, \qquad Z = \frac{z e \zeta}{kT}$ で定義される無次元化した泳動速度とゼータ電位を 示す。

## 図 3 いくつかの κa 値に対する電気泳動移動度とゼータ電位 の関係(図中の数字は κa 値を示す)

最近,新しい電気泳動移動度の測定技術が次々に開発 されている。ドップラー効果を利用する方法や回転回折 格子法などがその例である。これらの方法を用いると, 従来のゼータ電位の値のほかに,ゼータ電位の分布に関 する情報も得ることができる。

#### 3.1 顕微鏡電気泳動法

個々の粒子が顕微鏡で識別できる場合は,直接粒子を 観察しながら電気泳動移動度を測定する。測定セルは円 形断面のセル(毛細管)と矩形断面のセルがあるが,後 者のほうが測定しやすい。図4(a)に矩形電気泳動セル の一例を示す。顕微鏡の倍率は100~200倍程度が使い やすい。粒子径が小さすぎて顕微鏡で見えない場合に は,暗視野装置を取り付けて散乱光で観察すると,粒子 は夜空に輝く星のようにその存在を確かめることができ る。直流電源の電圧は,あまり高くするとジュール熱で セル内の対流を引き起こして測定を妨害する。通常,セ ル内の電位勾配は3~5 V/cmが適当である。電源は, 希薄塩水溶液の場合は白金板のような金属電極でもよい が,測定中電極からガスが発生すると粒子の運動が乱さ れるので,一般的にはAg-AgCl-KClや Cu-CuSO<sub>4</sub>の ような可逆電極を用いるほうがよい。

電気泳動測定を薄型ガラスセル内で行う場合の大きな 問題は,ガラス壁面で起こる電気浸透効果を伴うことで ある。ガラス壁は水溶液に対して負に帯電しているの で,電場を印加すると電気浸透効果で溶液が流動し,こ

ぶんせき 2004 5



図4 顕微鏡電気泳動測定装置(a)とセル中の流速の分布と座標の取り方(b)

の流れ $u_{osm}$ がコロイド粒子の真の電気泳動移動度uに 重ね合わされる。すなわち、顕微鏡で観察される見かけ の粒子泳動移動度 $u_{app} \ge u$ は次のように関係づけられ る。

 $u_{osm}$ はセルの深さhで放物線状に変化し、 $k = (セルの 幅/セルの深さ) \gg 1$ の場合、次の式で与えられる。

ここでbはセルの厚さの1/2,  $u_0$ は壁面 ( $h = \pm b$ ) での 電気泳動移動度を示す {図 4(b)参照}。従って,  $u_{osm} =$ 0を示すレベル  $h_s$  での $u_{app}$  が真の電気泳動移動度 u を 与える。この  $h_s$ を静止レベル (stationary level) と言 い,次式で与えられる。

$$h_{\rm s} = \pm \frac{b}{\sqrt{3}} = \pm 0.577b$$
 .....(16)

kがいろいろな値をとる場合の $h_s$ は、駒形<sup>5)</sup>により次式 で与えられている。

また,半径 *a* の円形断面セル(キャピラリー)の静止レベルも同様な取り扱いにより次式で与えられる。

電気泳動実験を速やかに行う場合は,あらかじめ静止レベルを計算しておき,そのレベルでの泳動速度だけを測 定すればよい。

顕微鏡電気泳動装置は、従来、各研究室で設計された 装置が多く利用されていたが、最近、便利な完成品もイ ギリスの Ranku Brother 社 (M-2型) やアメリカの PEN-KEM 社 (501型) から市販されている。

#### 3.2 回転回折格子法によるゼータ電位測定

この方法の測定原理は、基本的には顕微鏡電気泳動法 と同じであるが、粒子の泳動移動度をストップウオッチ で測定する代わりに回転回折格子と周波数解析装置を使 用している。図5に装置のブロックダイヤグラムを示 す。レーザー光で照射された分散粒子の結像は対物レン ズによって回折格子面に投影される。回折格子はゆっく りと回転しているので、格子の溝口がコロイド粒子の像 の輝点を横切るたびに光電管の出力にパルスが発生す る。このパルスの周期は回折格子の回転速度と粒子の泳 動移動度に依存するので、パルスの周波数を解析すれば コロイド粒子の電気泳動移動度が求められる。市販の装 置では、周波数解析や電場強度依存性などすべてのデー タを内臓したマイクロコンピュータで処理して、直接試 料の電気泳動スペクトルを記録計が描き出すように設計



図5 回転プリズム法の模式図



図 6 ラテックス-TiO<sub>2</sub>コロイド混合系の電気泳動移動度の分布

されている。

図6に、この装置によるポリスチレンラテックス-TiO<sub>2</sub> 微粒子混合試料の電気泳動移動度の分布曲線を示 す。分布曲線には、両試料成分に対応した二つのピーク が観察される。この装置を使用すると、二成分混合系や 多成分系の電気泳動移動度やゼータ電位を同時に測定す ることができる。

### 3.3 レーザー・ドップラー電気泳動法

光や音波が運動している物体に当たり反射あるいは散 乱すると、散乱光の振動数が物体の速度に比例して変化 するという"ドップラー効果"を利用して、ゼータ電位 を求めることができる。いま、入射ベクトル $k_0$ のレー ザー光が一定方向(入射光と粒子の運動方向のなす角 $\theta$ )

ぶんせき 2004 5

に泳動しているコロイド粒子に当たると、散乱光(ペク トル $k_s$ の振動数 $\omega_s$ はドップラー効果によって入射光 の振動数 $\omega_0$ から $\omega_d$ だけ変化する。この $\omega_d$ は次式で表 すことができる。

ここで

uは粒子の電気泳動移動度,nは媒質の屈折率, $\lambda$ は真空中での光の波長を表す。従って, $\Delta k$ は測定条件で定まる定数であるから,シフト量 $\omega_d$ が実験からわかれば、コロイド粒子のuが計算できる。

一般に,粒子の電気泳動で起こるドップラー・シフト 量(~100 Hz)は,入射光の振動数(5×10<sup>12</sup> Hz)に比 べて著しく小さい。このような小さな振動数の差を感知 することは,通常の測定では不可能に近いので,光の混 合法(光ビート法)が利用される。ビート法には,入射 光の一部と散乱光を混合させるヘテロダイン法と散乱光 どうしを混合させるホモダイン法があるが,前者の方法 が多く利用されている。ビートシグナルの振動数成分を 解析するには,FFT 理論(fast-Fourier-transform theory)に基づくFFTスペクトルアナライザーが利用 される。

図7にレーザー・ドップラー法電気泳動装置の一例 を示す。光源には10mWのHe-Neレーザーを用い, 散乱光はデイヒューザーで弱められた参照光とともにピ ンホールを通って光電子増倍管に入る。二つのビームは 光電子増倍管に当たって検知され,ビートシグナルを発 生する。発生したシグナルは増幅された後,FFT アナ



図7 レーザー・ドップラー法電気泳動装置の模式図

ライザーに入り,シグナルの振動数分布が*X*-*Y*レコー ダー上に描かれる。コロイド試料は矩形の水晶セルに注 入され,白金電極で電圧が印加される。電気泳動速度の 測定は,できるだけ手早く短時間のうちに行う必要があ る。それは,この方法では他の方法より高い電場が必要 であり,液の蒸発や発熱を防ぐためである。

市販されている日本製レーザー・ドップラー型電気泳 動装置(大塚電子 ELS-3000)では、セルの各レベル での泳動速度の測定を行い、深さに対して放物線関数に なることを確かめた後、静止レベルでの値からゼータ電 位とゼータ電位の分布曲線を小型コンピュータで表示す る方策がとられている。また、この装置を用いるとタン パク質などの分子コロイドのゼータ電位も比較的容易に 求めることができる。

## 4 濃厚分散系のゼータ電位測定

これまで述べたゼータ電位の測定法では,最大1% 程度の希薄分散系の測定に限られていたが,超音波振動 電位 (ultrasonic vibration potential; UVP) 法,あるい は動電音響 (electrokinetic sonic amplitude; ESA) 法 を用いると,濃厚状態 (70% 以下)で荷電粒子のゼー タ電位が測定できる。

図8は、荷電粒子の分散系に超音波を伝播させたと きの様子を模式化したものである。音場でのコロイド粒 子は音圧によって移動するが、より密な中心粒子はその 慣性でその場にとどまる傾向を示すが、周囲のイオン雰 囲気は大きく移動するため荷電粒子とイオン雰囲気の中 心にずれが生じ、これは超音波の周期に従って振動する 周期的な分極を引き起こす。この分極は、超音波の半波 長の奇数倍の位置に UVP と呼ばれる交流電圧を発生さ せる。

UVPは Smoluchowski により示された沈降電位の概 念と基本的に同じであり、その理論的取り扱いは、まず 希薄分散系について Enderby<sup>6)</sup>により行われた。一方, 濃厚系になると粒子間相互作用の効果を考慮する必要が あり、Levine ら<sup>7)</sup>のセルモデル理論を適用して UVP は



図8 超音波振動電位の発生原理

次式で表示された。

ここでPは音圧,  $\phi$ は粒子体積分率を示す。また,  $\gamma$ ( $\kappa a$ ,  $\phi$ ) は粒子間の電気的相互作用の効果を, また,  $\Omega$ ( $\phi$ ) は粒子間の流体力学的相互作用の効果を表す。こ こで,  $\gamma(\kappa a, \phi)/\Omega(\phi)$  は,  $\kappa a \gg 1$ の条件下では 1- $\phi$  で 近似できる<sup>8)</sup>。

$$UVP = \frac{2P}{\rho_0} \cdot \frac{\phi}{\lambda_0} \cdot (\rho_1 - \rho_0) \cdot \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r \zeta}{\eta} \cdot (1 - \phi) \quad (SI 単位)$$
.....(22)

従って、UVP を測定することにより、他の量が既知で あれば、上式を用いて濃厚系のゼータ電位が計算できる。

UVP 測定用装置は、PEN-KEM 社(アメリカ)か ら市販されている PEN-KEM-System-7000 が普及し ている。同様な濃厚スラリー用ゼータ電位計として Matec Applied Science 社(アメリカ)から ESA-8000 が市販されているが、この装置では電極間に超音波では なく高周波の交流電圧を印加し、これにより発生する粒 子の超音波をピエゾ素子で検知してゼータ電位を求める。 図9は UVP 法による測定結果の一例で、pH5の条



図 9 各試料のゼータ電位の濃度依存症(1×10<sup>-3</sup> mol/l KCl, pH 5,温度 20°C)

件で測定した単分散シリカ (silica) 及び3種類の表面 特性の異なる高分子ラテックス (St;ポリスチレンラ テックス, Nass;スチレンにスチレンスルホン酸ソー ダを共重合したラテックス, MA;スチレンにメタクリ ル酸を共重合したラテックス)のUVP値を式(22)で ゼータ電位に変換し、 $\phi$ に対してプロットしたものであ る<sup>9)</sup>。Silica, Stおよび MA ラテクッスのゼータ電位に は $\phi$ 依存性が認められず,これらの系ではLevine らの セルモデル理論に従うことがわかる。一方、表面にスル ホン酸基を多量に持つ Nass や、表面のカルボキシル基 が完全解離する pH9 での MA ラテックス系では、 $\phi$ の 増加で潜しくゼータ電位の降下が起こる。これは、 $\phi$ の 増加で粒子表面の電荷に満ちた表面層(hairy layer)が 重なり、粒子表面伝導が生じたためと思われる。

## 5 ゼータ電位と分散粒子の安定性

我々は経験的にゼータ電位の大きな粒子の分散系は安 定で、放置しても凝集しにくいことを知っている。とこ ろが、分散系の安定性の理論では粒子のシュテルン電位  $\phi_\delta$ が議論の対象であって、ゼータ電位という言葉は一 向に出てこない。ゼータ電位は、 $\phi_\delta$ を推定する手段と して利用されるに過ぎない。さらに、DLVO 理論によ ると、分散粒子の安定性は  $\phi_\delta$ がある程度以上大きくな ると  $\phi_\delta$ に依存しないことを結論するのである。その理 由は次のとおりである。

分散粒子の安定性は、粒子表面に形成された電気二重 層の重畳による静電反発ポテンシャル( $V_{\rm R}$ )とファン デルワールス引力( $V_{\rm A}$ )より成る全ポテンシャル曲線 を描き、その形から系の分散・凝集を論じることができ る。粒子間にポテンシャルの極大( $V_{\rm max}$ )が存在すれ ば安定であるが、 $V_{\rm max} \leq 0$ の場合はブラウン運動による 衝突で分散系は凝集する。特に $V_{\rm max} = 0$ を満足する対 イオン濃度は、分散系を凝集させるに必要な最小濃度



図 10 コロイド粒子のシュテルン電位 φ<sub>δ</sub>(ζ) と凝集濃度 C<sub>efe</sub>の関係

で、これを臨界凝集濃度(*C*\*)または凝析価と呼び、 平板粒子系の場合、次式で表される<sup>1)10)</sup>。

$$C^* = \frac{1.07 \times 10^5 \varepsilon^3 (kT)^5}{N_{\rm A} A^2 e^6 z^6} \gamma^4 \quad (\text{mo/l}) \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots (23)$$

水中,25℃では

 $\phi_{\delta}$ は式(24)で $\gamma$ の中に含まれているだけである。 $\gamma$ は $\phi_{\delta}$ が増大すると急激に1に近づく関数である。その ため、 $\phi_{\delta} \ge 100 \text{ mV}$ 以上ならば $\gamma = 1$ と近似され、 $C^{*}$ は 対イオンのイオン価(z)や粒子のファンデルワールス 定数(A)などに影響されるが、 $\phi_{\delta}$ の影響は全く消失 してしまうことがわかる。

問題は、実際のコロイド系ではζ≥100mVの場合は 大変まれで、多くの系がζ≦50 mV の値をとることであ る。特にζが20mVや10mVという値になるとyの変 化は著しくなるので、ゼータ電位が系の安定性に支配的 な影響を及ぼすようになる。図10は、式(24)よりC\* と $\gamma$ に含まれる  $\phi_{\delta}$  (= $\zeta$ )の関係を二種類のA 値を仮定 して表したものである。 $\phi_{\delta}$ が小さくなると $C^*$ は著しく 小さな値となり凝集しやすくなることがわかる。特に,  $\phi_{\delta} \leq 30 \text{ mV}$ になると $C^*$ はzやAの値にあまり依存せ ず、専らゼータ電位の大きさのみに影響されることがわ かる。溶液中に界面活性なイオン、例えばイオン性界面 活性剤や多価イオンが存在すると、これらが粒子表面に 特異吸着して ψ を大きく変化させることは既に述べ た。従って、このような系では界面活性イオンの濃度に よって分散粒子の安定性が支配され、わずかなイオンの 添加により系の凝集が引き起こされることになる。

分散性に対する電位決定イオンの効果もこれに似てお り特異的である。例えば AgI ゾルを考えると、このゾ

ぶんせき 2004 5

ルの表面電位は液中の $Ag^+$ または $I^-$ イオン濃度に よって決まり、 $Ag^+$ 過剰ならば正、 $I^-$ 過剰ならば負に 帯電する( $[Ag^+]$ [ $I^-$ ]= $10^{-16}$ 、溶解度積)。そこで、 負のAgIゾルに $AgNO_3$ を加えて $PAg(-log[Ag^+])$ を6にすると粒子の表面電荷が零となり、 $\phi_{\delta} = \zeta = 0$ 、 従って $V_R = 0$ となるのでゾルは凝集する。普通の一価 イオンでは $10^{-1}$  mol/l程度加えないと粒子は凝集しな いのに、電位決定イオン $Ag^+$ ならばわずか $10^{-6}$  mol/l で凝集が起こるわけである。

各種の金属酸化物,水酸化物の表面では H<sup>+</sup> と OH<sup>-</sup> が電位決定イオンとなり,系の pH 値によって表面電位 が大きく変化する。従って,ある特定の pH(pH<sup>0</sup>) で表 面電位が零となり,電気泳動などの界面導電現象を全く 示さなくなる。この点は等電点(iso electric point)と 呼ばれ,酸化物の種類によって異なった値をとる。表1 に典型的な酸化物表面の水溶液(25°C)における pH<sup>0</sup> の値を示す<sup>11)</sup>。各酸化物微粒子の分散液は,表に示さ れた等電点の pH に近づけると静電反発力が消失して凝 集するので,分散を安定化させるためには系の pH を pH<sup>0</sup> からできるだけ遠ざけることが重要である。また, 各酸化物粒子の pH<sup>0</sup> の値はいずれも電気泳動法や流動 電位法などの界面動電測定により,ゼータ電位が零の点 として実測された値である。

# 8 おわりに

ゼータ電位は、コロイド・界面化学の分野のみなら ず、食品や生物学などの領域でも時々出会う量であり、 これ等の系の物性と深いかかわりを持っているが、一般 には取り付きにくい概念として敬遠されがちである。本 稿では、この点を考慮してゼータ電位をできるだけやさ しく解説し、誘導される式も利用しやすいように整理し たつもりである。本稿によって、ゼータ電位が研究者、 技術者の間で、より親しまれるようになり、抵抗なく測 定されるようになることを切に望むものである。

### 文 献

- 北原文雄,古澤邦夫:最新コロイド化学,(1990),(講談 社).
- 2) D. C. Henry: Proc. R. Soc. London, Ser. A, 133, 106 (1931).
- P. H. Wiersema, A. L. Loeb, J. Th. G. Overbeek; J. Colloid Interface Sci., 22, 78 (1966).
- R. W. O'Brien, L. R. White : J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, 74, 1607 (1978).
- 5) 駒形作次:界面電気概要, p. 63 (1953), (晃光堂).
- 6) J. A. Enderby: Proc. Phys. Soc., 207A, 321 (1951).
- S. Levine, G. Neale, N. Epstein : J. Colloid Interface Sci., 57, 423 (1976).
- B. J. Marlow, D. Fairhurst, H. P. Pendse: *Langmuir*, 4, 611 (1988).
- Y. Hozumi, K. Furusawa: Colloid Polymer Sci., 268, 469 (1990).
- 10) 北原文雄, 古澤邦夫, 尾崎正孝, 大島広行: ゼータ電位,

#### 表1 各種酸化物表面の電荷零点(または等電点)

$\alpha$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 9.1~9.2 sp	
$\gamma - Al_2O_3$ 7.4~8.6 "	
α-AlOOH (ベーマイト) (7.7 "	
(9.4 me)	р
γ-AlOOH (ジアスボア) 5.5~7.5 "	
α-Al(OH) <sub>3</sub> (ギブサイト) 5.0~5.2 "	
γ-A1(OH) <sub>3</sub> (バイヤライト) 9.3 "	
BeO 10.2 eo	
CdO 10.4 meg	р
$Cd(OH)_2$ >10.5 "	
Co(OH) <sub>2</sub> 11.4 "	
Cu(OH) <sub>2</sub> (水和物) 7.7 "	
CuO 9.5 "	
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (水和物) 6.5~7.4 ″	
$Fe(OH)_2$ 12.0 eo	
Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> 6.5 "	
α-FeO <sub>3</sub> (赤鉄鋼) 8.3 meg	р
γ-FeO <sub>3</sub> 6.7~8.0 "	
$Mg(OH)_2$ 12.4 eo	
$Mn(OH)_2$ 12.0 meg	р
HgO 7.3 "	
NiO 10.3 "	
Ni(OH) <sub>2</sub> 11.1 "	
PuO <sub>2</sub> 9.0 "	
SiO <sub>2</sub> (石英) 1.8~2.5 <i>"</i>	
2.2~2.8 sp	
SiO <sub>2</sub> (ゾル) 1~1.5 meg	р
ThO <sub>2</sub> 9.0~9.3 "	
SnO <sub>2</sub> 6.6~7.3 "	
$TiO_2$ (合成ルチル) 6.7 sp	
TiO2 (天然ルチル)     5.5     "	
$TiO_2$ (天然ルチル) 4.8 meg	р
TiO <sub>2</sub> (合成アナターゼ) 6.0 〃	
WO <sub>3</sub> (水和物) 0.5 <i>"</i>	
$V_3O_8$ 4 sp	
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (水和物)     9.3     meg	р

sp:流動電位法,eo:電気浸透法,mep:電気泳動法

p.102 (1995), (サイエンティスト社).

C. A. Parks: Chem. Rev., 15, 177 (1965); R. H. Yoon, T. Salman, G. Donnay: J. Colloid Interface Sci., 70, 483 (1979).



古澤邦夫 (Kunio FURUSAWA) 筑波大学産学リエゾン共同研究センター (〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1)。東京教育大学大学院理学研究科博士 課程修了。理学博士。《現在の研究テー マ>微粒子分散系の化学,特に溶存高分子 の枯渇効果の研究並びに複合超微粒子の調 製。《主な著書》"Electrical Phenomena at Interfaces;Fundamental, Measurements and Applications" (Marcel Dekker)。《趣味》スポーツ観戦,小旅行。 E-mail:furusawa-k@muh.biglobe.ne.jp